



微細加工PFセミナー

微細加工技術は、「パターン作製技術」「薄膜形成技術」「エッチング技術」など、複数の作製技術の組み合わせにより成り立っています。今回、我々北大微細加工プラットフォームにて今年度導入致しましたレーザー直接描画装置(ハイデルベルグ社製 DWL66+)および描画支援ツール(GeniSys社製 BEAMER)について、メーカーの方々を招いてのWEBセミナーを開催することとなりました。今回のセミナーにより、皆様方のレーザー描画・電子ビーム描画によるパターン作製技術向上に貢献できることを願っています。

開催日時: 2020年12月16日(水), 9:30~12:00

Zoomによるオンラインセミナーです。

事前申し込みが必要です。締切12/14(月)

氏名・メールアドレスをご記入のうえ、下記メールアドレスまで申し込みください。

— プログラム —

- 9:30-9:35 開催のご挨拶
- 9:35-10:25 「DWL66+のご紹介」
ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社 上瀧英郎 様
DWL66+は最小線幅300nmの描画からグレイスケール露光まで様々なアプリケーションに対応できるレーザー直接描画装置です。その機能やアプリケーション事例をご紹介します。
- 10:25-10:40 「レーザー直接描画装置 DWL66+の基本操作について」
北海道大学電子科学研究所 ナノテク連携推進室 教授 松尾保孝
本年度導入致しましたハイデルベルグ社製DWL66+について、その基本操作について紹介させていただきます
- 10:40-10:50 休憩
- 10:50-11:50 「電子ビーム及びレーザー描画における露光データ最適化ツールのご紹介」
GeniSys株式会社 清水諭 様
電子ビームや紫外レーザーを使用した微細加工分野では、一般的に電子散乱効果(近接効果)や実効ビーム径、パターン粗密などの様々な要因を加味した上で、露光現像後に設計通りの寸法を得るための事前データ補正技術が必須となります。本講演では、ソフトウェア(BEAMER)を使用したデータ補正の実際についてご紹介します。
- 11:50-12:00 閉会のご挨拶・諸連絡

申込み・問い合わせ先

北海道大学ナノテクノロジー連携研究推進室

Tel: 011-706-9340

e-mail: nanoplat@cris.hokudai.ac.jp